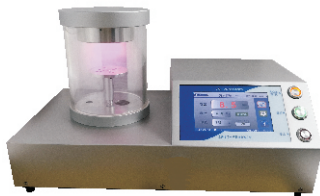


全自动溅射仪

MicroHezao GVC-1000

MicroHezao GVC系列是全自动可编程的溅射仪，该系列产品拥有优秀的溅射系统，可以更换不同的金属靶材（金，铂，银，铱，铬，铜等），实现高要求的细粒涂层。GVC系列为您提供优质的样品制备，轻松助您取得更好地材料研究样品，获得高质量的显微镜观结果。MicroHezao电镜制样技术团队，为您提供全套解决方案。



GVC-1000 全自动离子溅射仪

靶材：
Au $\phi 57 \times 0.12\text{mm}$
Pt $\phi 57 \times 0.12\text{mm}$
支持靶材定制



真空离子溅射仪为扫描电镜用户在制样过程中提供了更广泛的选择，以便适用支持扫描电子显微镜所需的涂层要求。在结构设计秉承人体工学设计理念设计,紧凑及经典的外观设计和更小的桌面占用面积为您大大节约了实验室空间。人机界面方面更加注重人性，简单智能,触摸屏,一键控制。

对于SEM样品常规适用黄金溅射，GVC-1000提供了一个低成本的解决方案，同时可以通过更换不同的靶材（金、铂、铱、银、铜等），以达到更细颗粒的涂层。同时通过智能的人机界面精确、简单、方便控制仪器，同时具有估算镀层厚度，实时显示真空度，溅射电流。设定溅射时间。以及靶材的剩余情况GVC-1000是专用于扫描电镜（SEM）的样品喷金仪器,能够极为有效的提供样品的导

溅射技术

在电子显微镜领域内，往往需要对样品进行表面镀膜从而使样品表面成像或者图像质量得到改善。在样品表面覆盖一层导电的金属薄膜可以消除荷电反应，降低电子束对样品表面的热量损伤，可以提高SEM对样品进行形貌观察,所需要的二次电子信号量。



GVC-1200 半自动离子溅射仪

发现其特点

- 一键式镀膜
- 更小的桌面占用面积
- 直观的操作界面
- 全自动化控制
- 应用范围更广泛
- 镀膜更换
- 结果最佳
- 使用更简便
- 操作更平顺



系统特点：

- 仪器采用微处理器控制，自动化程度高，精确控制、易于操作；
- 5英寸彩色触摸屏，可实时显示真空度、溅射电流、设定溅射时间、剩余溅射时间、膜厚估算等；
- 可溅射金、银、铜、铂等常用靶材；
- 实时显示设备运行时间、靶材使用时间，方便了解设备情况；
- 内置过流、真空保护，在溅射电流过高或真空较差时自动中断，安全可靠；
- 高灵敏度微调阀，可精确控制气体流量；
- 靶材组件采取翻盖式设计，操作简洁、方便；
- 内置用户使用向导和说明书，方便用户操作。

全自动溅射仪 MicroHezao GVC-1000

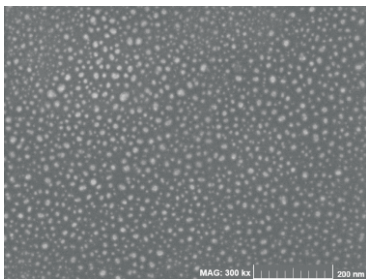
指标参数

外形尺寸： 424×290×265 (mm)	工作电压： 200-240VAC 50Hz
溅射电压： DC2400V	控制模式： 微处理器控制
最大功率： 500W	溅射电流： ≤50mA
溅射时间： ≤600s	极限真空： 0.1Pa
工作真空： ≤30Pa	膜层厚度： 内置膜厚估算 (金靶)
真空测量： 电阻规	真空速率： 1L/s

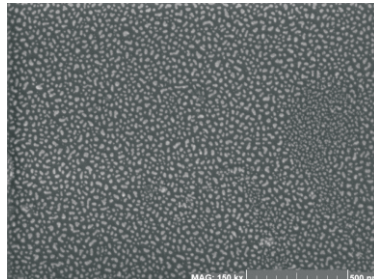
适用配套：Zeiss、JEOL、Hitach、FEI、Tescan、Phenom等扫描电镜

GVC-1000离子溅射仪喷金效果图

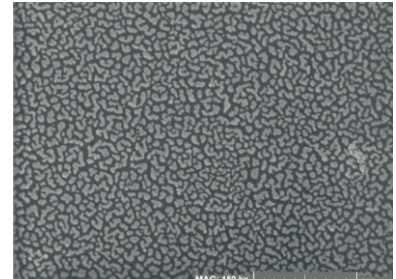
金颗粒分布的均匀性和颗粒大小,在不同时间内的分布都很均匀,颗粒度在10-20nm左右。



15s喷金图



30s效果图

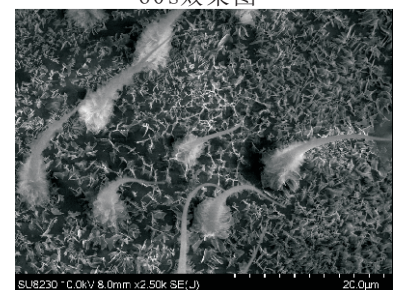


60s效果图

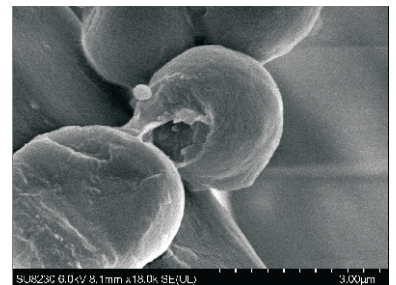
适用溅射样品类型:

试样是电子束敏感的样品,主要包括生物样品,塑料样品等。SEM中的电子束具有较高能量,在与样品的相互作用过程中,它以热的形式将部分能量传递给样品。如果样品是对电子束敏感的材料,那这种相互作用会破坏部分甚至整个样品结构。这种情况下,用一种非电子束敏感材料制备的镀层就可以起到保护层的作用,防止此类损伤;

试样是非导电的样品,由于样品不导电,其表面带有“电子陷阱”,这种表面上的电子积累被称为“充电”。为了消除荷电效应,可在样品表面镀金属导电层,镀层作为一个导电通道,将充电电子从材料表面转移走,消除荷电效应。在扫描电镜成像时,溅射材料可以增加信噪比,从而获得更好的成像质量。



发丝喷金后效果图



真丝喷金后效果图